(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2000-511220 (P2000-511220A)

(43)公表日 平成12年8月29日(2000.8.29)

(51) Int.CL'

識別記号

C 0 8 G 63/60

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 8 G 63/60

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 15 頁)

(21)出願番号

特顧平9-542271

(86) (22)出願日

平成8年5月28日(1996.5.28)

(85)翻訳文提出日

平成10年11月30日(1998.11.30)

(86)国際出願番号 (87)国際公開番号

PCT/US96/07779 WO97/45469

(87)国際公開日

平成9年12月4日(1997.12.4)

(71)出願人 イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・

アンド・カンパニー

アメリカ合衆国 19898 デラウェア州 ウィルミントン マーケット ストリート

1007

(72)発明者 ワゴナー, マリオン, グレン.

アメリカ合衆国 19707-9803 デラウェ ア州 ホッケシン アール・ディー、3

ア州 ボッケシン アール・ディー。; セージウェイ 36

(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外2名)

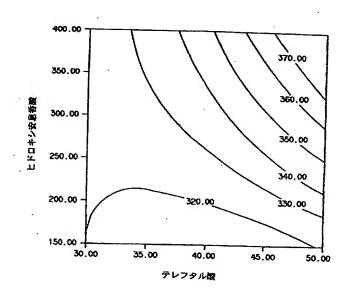
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶ポリエステル樹脂

(57)【要約】

ヒドロキノン、テレフタル酸、2,6ーナフタレンジカルボン酸、および4ーヒドロキシ安息香酸から作られ、選択された組成範囲を有する液晶ボリエステルは、融点が約350℃以下という優れた物理的特性を持ち、かつ容易に製造できる。このボリマーは成形樹脂として有用である。

FIG.1



【特許請求の範囲】

1. 下記式の繰り返し単位を含み、

(IIIb)

繰り返し単位(I)が前記全繰り返し単位のうちの53から60モルパーセントを構成し;

繰り返し単位 (II) が前記全繰り返し単位のうちの18.5から25モルパーセントを構成し;

繰り返し単位(IIIa) + (IIIb)が前記全繰り返し単位のうちの18.5から25 モルパーセントを構成し;

(IIIa): (IIIb)のモル比が35:65から45:55であり;および

(II) の [(IIIa)+(IIIb)] に対するモル比が約1. 0であることを特徴とする液晶ポリエステル。

【発明の詳細な説明】

液晶ポリエステル樹脂

発明の背景

本明細書では、ヒドロキノン、テレフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸、および4-ヒドロキシ安息香酸から作られ、約350℃以下の融点といった優れた物理的特性を有し、かつ迅速に製造することができる液晶ポリエステルについて記載する。

サーモトロピック液晶ポリマーは公知であり、成形樹脂(例えば、電気コネクタおよび自動車部品用)、フィルム、バリア樹脂、および熱可塑性プラスチックの他の用途に有用である。これらのタイプのポリマーは公知であるが、優れた特性を持ち、調製が容易で、かつ比較的低価格であるかかるポリマーに対する要望がある。

発明の要旨

本発明は、下記の式の繰り返し単位を含み、

トを構成し;

繰り返し単位(II)が前記全繰り返し単位のうちの18.5から25モルパーセントを構成し;

繰り返し単位(IIIa) + (IIIb)が前記全繰り返し単位のうちの18.5から25 モルパーセントを構成し;

(IIIa): (IIIb)のモル比が35:65から45:55であり;および

(II) の [(IIIa) + (IIIb)] に対するモル比が約 1 であることを特徴とする液晶ポリエステルに関する。

発明の詳細

本明細書に記載する液晶ポリエステルは、繰り返し単位(I)が4ーヒドロキシ安息香酸(HBA)から誘導され、繰り返し単位(II)がヒドロキノン(HQ)から誘導され、繰り返し単位(IIIa)がテレフタル酸(TPA)から誘導され、繰り返し単位(IIIb)が2,6ーナフタレンジカルボン酸(NDA)から誘導される完全な芳香族ポリエステルである。HQの全モル量がTPAとNDAの合計モル量と本質的に等しいことを当業者は理解できる。好適なポリマーにおいて、繰り返し単位(I)は前記全ポリマー繰り返し単位のうちの53から60モルパーセントを構成し、繰り返し単位(II)は前記全ポリマー繰り返し単位のうちの

20から23.5モルパーセントを構成し、繰り返し単位(IIIa)および(IIIb)は、合わせてポリマーの全繰り返し単位のうちの20から23.5モルパーセントを構成する。

図面の簡単な説明

図 1 は、2 つのポリマー組成変数に対する融点の等高線図(conter plot)である。2 つのポリマー組成変数とは、ポリマーにおけるHBA [単位(I)] の百分比、および(IIIa):(IIIb)の比(上述の通りである)におけるTPA (IIIa) の量である。示された各等高線は、一定値の融点を表す。

図2は、2つのポリマー組成変数に対する完成時間(時間単位)の等高線図である。2つのポリマー組成変数とは、ポリマーにおけるHBA [単位(I)] の百

分比、および(IIIa): (IIIb)の比(上述の通りである)におけるTPA (IIIa)の量である。各等高線は、一定値の完成時間を表す。完成時間とは、撹拌機においてトルクにより評価したとき、完全真空下で特定の粘度に達するまでに要した時間数を意味する(実施例を参照されたい)。

等高線図の計算には実施例1~8のデータを使用したが、これらの実施例で作られたポリマーの全てが特許請求されている組成範囲内ではない。データは、米国イリノイ州エヴァンストンのSYSTAT、Inc. 製のWindows用SYSTAT、Version 5 と呼ばれるプログラムを使用し、かつ等高線図ルーチンを使用して、統計的に分析し計算した。

図1から、ここで選択した組成範囲のポリマーの融点が約350℃以下であることが明らかである。これは、高品質ポリエステルの合成にとって重要である。本発明者らの経験では、ポリエステル液晶ポリマーを作るために350℃よりずっと高い温度を必要とする場合、出発原料および/またはポリマー製品の劣化が著しく増加し、それによってポリエステルの過剰な変色など、望ましくない影響が生じることがあった。ポリマーの結晶化を防止するために、通常、重合はポリマーの融点またはそれ以上で実行される。したがって、約350℃以下の融点が望ましい。しかし、ポリマーの使用温度を高くするためには、融点もできるだけ

高く、すなわちこの場合は350℃近くにする必要がある。選択されたポリマー 組成は、図1に示すように、そのような融点を持つ。

経済性(重合装置の生産性の向上)のため、および高温におけるポリマーの劣化を最小にするために、完成期間もまた適度に短くしなければならない。図2から分かるように、約50モルパーセント以上のHBA誘導繰り返し単位を有するポリマーは、意外にも比較的短い完成時間を持つ。完成時間の絶対値は、使用するモノマーの品質、使用する装置の大きさや形状等によって変化するが、図2に示す完成時間の相対的程度は、他の全ての変数を一定に保った1組の重合においては変化しない。

したがって、HBA、HQ、TPAおよびNDAから作られる液晶ポリエステルの選択された組成範囲は、優れた特性、製造の容易さ、および合成中のポリマ

一の潜在的な劣化の減少という予想外の組合せを持つことが発見された。

この液晶ポリエステルは、芳香族ポリエステルを生成する熟練者には周知の方法で生成することができる。例えば、塩基性モノマー(HQの2つのヒドロキシル基およびHBAの1つ)におけるヒドロキシル基の酢酸エステル(またはその他の低アルキルエステル)を二酸塩基と混合し、加熱して、徐々に副生物の酢酸を除去しながら、最終的に所望のポリマーを生成することができる。この方法の変形例では、化学量論的な量よりわずかに多い無水酢酸を全てのモノマーの混合物に加え、混合物をその沸点まで加熱し、短時間そのままにしてヒドロキシル基をアセチル化させ、次いで重縮合を行うことで酢酸塩をその場で形成することができる。別法として、蒸留によって副生物のフェノールを除去しながら、モノマーにおけるカルボン酸基のフェニルエステルをヒドロキシル基と反応させることもできる。反応物は通常、最終的に真空下で300℃以上に加熱して、所望のポリマー分子量を達成する。

本明細書に開示するポリマーは、ガラス繊維、ガラス球、フレーク状ガラス、 炭素繊維、カーボンブラック、および例えば粘土などの鉱物、顔料、着色料、安 定剤、その他のポリマー、強化剤、酸化防止剤、難燃剤、および可塑剤などの充 填剤および/または補強剤など、通常熱可塑性プラスチックと混合される様々な 材料と混合または配合することができる。

実施例

<u>実施例1~8</u>

3リットルのガラスケトルを反応容器として使用した。ビスマスとスズから成る電気加熱式金属浴を介して、容器に熱を供給した。50:1減速ギャを備えたCole-Parmer Master Servodyne Unitにより撹拌を行った。操作中、トルク(直流ミリボルト単位)およびRPMを常時表示させた。容器から蒸発する蒸気は、ワンピース型2.5cmO.C.ガラスカラムを通り、スプリッタを備えた水冷式コンデンサを通って、凝縮された留出物を1リットルのメスシリンダへ排出した。反応のアセチル化、重合、および蒸留段階の前に、窒素ブランケットを設けるために、システムに窒素放出弁を取り付けた。蒸留物の大部分が放出した後、

合成の部分真空段階の間圧力低下を制御するために、システムの真空ポンプ側に 追加の窒素放出弁を取り付けた。ケトル内にハステロイ/撹拌機を配置し、耐圧 締まり嵌め用のOリングを備えたテフロン/套管を介してケトル頂部を通して誘 導した。

次に、表面をゴム引きしたU字型ランプ内に容器全体を滑り込ませ、しっかりと固定した。容器に安全バブラ(safety bubbler)を介して窒素を供給し、針弁で制御して窒素雰囲気を確保した。次に、ワンピース型ガラス柱、スプリッタ付水冷コンデンサ、およびメスシリンダを取り付けた。モノマーと無水酢酸の視覚的に適正な混合物が得られるまで撹拌を60rpmで開始し(約1~2分)、次に50rpmに減速した。この時点で、170℃に予熱した金属浴を持ち上げ、容器の反応部分を覆った。蒸発した酢酸/無水物を完全に反応容器に還流しながら、アセチル化を行った。撹拌速度は、時計回り方向(上から下を見たとき)に50rpmに維持した。40分間の完全還流(ジオールの完全なアセチル化を保証するために)の後、還流塔のスプリッタを介して酢酸留出物を除去し、温度が310℃に達するまで、20分ごとに20℃ずつ設定温度を上げていった。310℃で約20分後に、設定温度を370℃に上げて残留酢酸を追い出し、完成した溶融樹脂を後で適用する真空下で維持した。期待した酢酸の90%以上を回収した

後、ガラス柱、コンデンサ、およびメスシリンダを取り外し、圧力/真空読取り装置にも取り付けられた窒素管路を設置した。撹拌軸の周囲のテフロン/套管を充分に固定し、システムの圧力が8. $4\times10^4\mathrm{Pa}$ (絶対圧)に達するまで、徐々に真空にしていった。10分間の8. $4\times10^4\mathrm{Pa}$ (絶対圧)の後、約6. $7\times10^4\mathrm{Pa}$ (絶対圧)に10分間減圧し、10分ごとに $1. 7\times10^4\mathrm{Pa}$ ずつまたは約1. $7\times10^4\mathrm{Pa}$ (絶対圧)まで樹脂の挙動(すなわち発泡など)を考慮しながら減圧した。次に、10分の間隔で、圧力を $6. 7\times10^3\mathrm{Pa}$ (絶対圧)に下げ、さらに $2. 4\times10^3\mathrm{Pa}$ (絶対圧)に下げることで、完全な真空にした。サーボダイントルクメータのトルクの読みが約69ミリボルトを超えるまで、システムは完全な真空(27から66 Pa (絶対圧)状態を維持し

た。この時点で、次にrpmを30に低下し、トルクは90ミリボルトを超えるまで増大させた。

その後、真空ポンプの弁を閉じ、システムが大気圧に達したことを示すまで、ケトルを窒素で安全バブラを介して加圧した。撹拌を停止し、金属浴を下降し、システムの装備を取り外した。高温のケトルをコルクリング上に置き、頂部を取り外した。撹拌軸を持ち上げて外し、接着樹脂をハサミで切り払うか、パテナイフで削り取った。ケトルの上部内側部分に接着している昇華した不純物は、ケトル内の残りの樹脂の汚染を防止するために、ケトルを横にして、へらで削ることによって除去した。これを行った後、ケトルを金属浴に戻して樹脂を加熱した。ケトルを浴内に維持したまま、大きいへら型の道具でポリマーを取り出した。一般的な収率は、0.8kgのポリマーを期待したときに約95%であった。

最初に、生成されたままのポリマーに25 \mathbb{C}/\mathcal{G} の加熱率で、熱示差走査熱量測定法 (DSC) を使用して、生成されたポリマーの融点 (\mathbf{Tm}) を測定した。溶融吸熱のピークを \mathbf{Tm} とみなした。

得られたポリマーを、二軸スクリュー押出機でガラス繊維と混合し、30重量パーセントのガラス繊維を含む組成物を得た。この組成物をバレル温度が約330~350℃の単軸スクリュー射出成形機で成形して、標準試験片を得た。ASTM D-638の方法を使用して引張り特性を測定し、ASTM D-790によって曲げ率特性を測定し、ASTM D-648により1.82MPaの負

荷時の熱変形温度(HDT)を測定した。

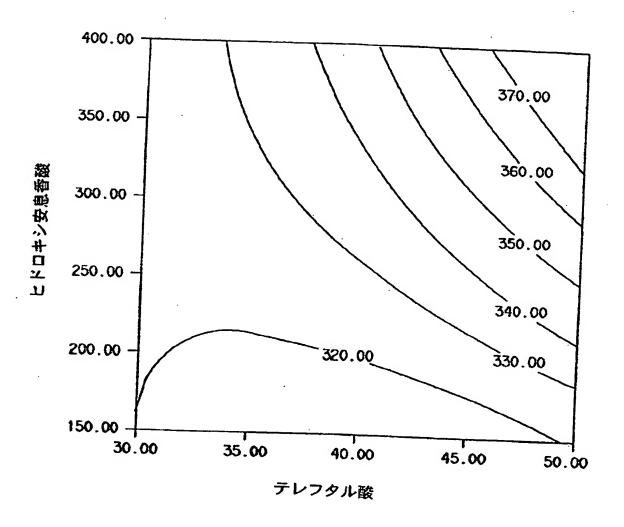
充填剤を含まないポリエステルの完成時間およびTm、ならびにガラス繊維を 充填したポリエステルの物理的性質を表Iに示す。

				TOH	ပူ			ž		791	200	607	287	207	/07	286		789
				***	田り角灰	2		130	103	3	176		181	180		82	15/2	
				単い数	•	CP3		17.9	0 %		12,0	1.61	16.4	12.5	1	14.3	11.2	13.3
				引張り伸び	•	*	,	٠.٥	2.0		2.2	0.7		2.3	-		2.4	2.6
				引張り強度	, w.	INITA	130		138	5	761	143		/+1	143		130	150
			1	元成時間	Ė			200	0.33	118		1.17	0.78	2	1.22	64.0	7.77	1.13
			Ta	ပူ		3:5	200	3/72	ê.	328		337	342	100	75,	PyL		333
			HBA			42.0	14.7	1 99		0.00	444	2.5	63.6	009	200	900	407	A. OO
出衆の一	%		YOY YOY			171		10.0	13.3	43.3	12.2	90	10.9	13.0		0.01	200	
おしなしの	H	ŕ	ζ.			₹ <u>-</u>	!	6	8		10.0	9.3	(",	7.0	907	10.0	8.0	
	i	CH	y :			5.8.2	6.7	10.7	22.2		22.2	18.7		20.02	200	233	20.0	
		日本記述明	一次他四曲九			-	,	,	~		+	8		٥	7	1	×	

表

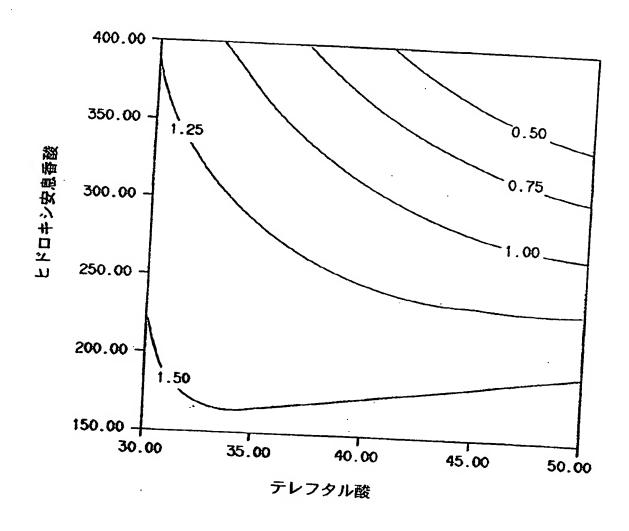
[図1]

FIG.1



[図2]

FIG.2



【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT .	
		trucer 12	al Application No
Ą. U.Ą	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER 0 C98G63/60	PC1/U!	S 96/07779
Actording	g to international Patent Classification (IPC) or to both national dass DS SEARCHED	ification and IPC	
	tation searched other than marainism documentation to the except that		
Bectronse	data have consulted thering the international search (name of data ba-	w and, where pracecal, search terms (med)
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category '	Chance of document, with indication, where appropriate, of the re	ievani passages	Relevant to claim No.
X.	US,A,4 169 933 (JACKSON WINSTON J AL) 2 October 1979 see column 5, line 35 - line 61;	_	1,2
	MACROMOLECULES, vol. 16, no. 7, 1983, pages 1027-1038, XP002022434 W.J. JACKSON, JR: "Liquid Crysta Polymers" see page 1030; figure 3	1	1,2
	EP.A.O 357 207 (EASTHAN KODAK CO) 1990 see examples 2,5		1,2
		/	
	ner documents are hined in the continuation of box C. Regorns of cited documents:	X Patent family members are being	ed in Annel.
" doesene conside	rat defining the general state of the art which is not seed to be of particular relevance.	bater document published after the corpropery date and not in conflict cried to understand the principle of invention	r theory underlying the
documer which is retailor documer other m	as which may sknow doubts on priority etaun(t) or a sted to establish the publication date of another or other specual resson (as specified) as referring to an oral disclosure, use, exhibition or many and problems of the international filing date but	document of particular relevance: t cannot be connected movel or can involve an inventive step when the document of particular relevance: ti cannot be connected to involve an document as combined with one or ments, such combination being obvinithes.	un de Componies to deciment is taken alone he claimed inventus lavintive siep when the more other such docu- ecus de person skilled
	setual completion of the international search	document member of the same pate Date of making of the international	
10	January 1997	1 1, 02,	
	ailing address of the BA European Patent Office, P.B. 5811 Patentiaan 2 NL - 2780 HV Ripropia	Authorized officer	J.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

C/Contimi	2006) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PC:/US 96/07779					
Category	Citation of documents considered to Be relevant.	Helatimat to dam \					
		Relevant to claim No.					
A	US,A,4 337 191 (FAVSTRITSKY NICOLAI A) 29 June 1982 see column 4, line 6 - line 42 see claim 1	1,2					
	, ·						
		·					
	•						
* 1							
1							

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (passent family annual (July 1992)

. E	nformation on patent family men	PC1/US 96/07779			
Patent document cited in search report	Publication date	Paterit fami member(s	Publication date		
US-A-4169933	02-10-79	FR-A- 2 GB-A,B 2 JP-C- 1 JP-A- 54	2834537 2400043 2002404 480669 030290 019530	22-02-79 09-03-79 21-02-79 10-02-89 06-03-79 22-04-88	
EP-A-0357207	07-03- 9 0	CA-A- 1 EP-A- D JP-T- 4	849499 321672 426730 500081 901511	18-67-89 24-08-93 15-05-91 09-01-92 22-02-90	
US-A-4337191	29-06-82	CA-A- 1:	141083	98-92-83	

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, L U, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF , CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(KE, LS, MW, SD, S Z, UG), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD , RU, TJ, TM), AL, AM, AT, AU, AZ , BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, I S, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR , LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN; . MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, S D, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT , UA, UG, UZ, VN (72)発明者 サミュエルズ,マイケル,ロバート.

アメリカ合衆国 19808—2706 デラウェ ア州 ウィルミントン ニュー ケント ロード 5116